



● FOR IMMEDIATE RELEASE

[報道発表](#)

2016年2月23日

EBEAM INITIATIVE TO EXPAND EDUCATION EFFORTS ON EBEAM TECHNOLOGY REQUIREMENTS FOR EUV AND NANOIMPRINT LITHOGRAPHY

イービームイニシアチブが EUV ならびにナノインプリントリソグラフィーの電子ビーム技術への要求に対する領域までその啓蒙的努力を広げる計画

Canon becomes latest company to join eBeam Initiative

キャノンが新たにイービームイニシアチブのメンバーに

報道関係各位：

SAN JOSE, Calif., February 23, 2016—

2016年2月23日（現地時間） 米国、カリフォルニア州、サンホゼ 発

電子ビーム(eBeam)技術による新しい半導体製造技術の啓蒙と促進を専門的に取り上げる公開の業界団体であるイービームイニシアチブ（eBeam Initiative）は本日、2016年における当団体の重要施策を遠紫外線（EUV）露光、ナノインプリント露光（nanoimprint lithography (NIL)）そしてマルチビーム（multi-beam）マスク描画を支援するための電子ビーム技術への業界の注目度を高めるためにその啓蒙活動範囲を広げると発表しました。

これらの話題は、サンノゼコンベンションセンターで開催される、SPIEのアドバンストリソグラフィー学会期間中の本日、イービームイニシアチブのメンバー及び報道各社を招いた年次昼食会で、業界の著名な方々により、取り上げられる予定です。

関連するニュースとして、キャノンがイービームイニシアチブに会員として参画し、半導体フォトマスク及びリソグラフィーのサプライチェーンの40機関以上からなる会員社及びア

-more-

ドバイザーの一員として同社の NIL を含む半導体技術に対する独自の将来展望とリーダーシップを当イニシアチブに持ち込み貢献する事になりました。

イービームイニシアチブの代表幹事社 D2S の最高経営責任者 (CEO) である藤村晶 (Aki Fujimura) 氏は、「キヤノン殿をイービームイニシアチブの新たなメンバーとしてお迎えできる事を喜ばしく思います。半導体製造にどのような露光技術が使われようとも電子ビーム露光技術は必須のものです。その意味で、イービーム界に重要な発言を頂ける様になる事と、大いに興奮を覚えます。キヤノン殿のナノインプリント露光における草分け的な研究は次世代半導体技術の開発に重要です。電子ビーム技術の重要性に鑑み、フォトマスク業界や半導体業界を啓蒙するための、キヤノン殿が目下進行中の協調的努力へ支持いただけることを期待しています。」と述べています。

イービームイニシアチブが、半導体とフォトマスク製造のサプライチェーン全体からの業界識者 64 人へ昨年行った年次調査では、回答者の大多数は 2018 年末までにマルチビームマスク描画機がクリチカル層向けマスクの量産に使用されるであろうと回答しています。

この期待は即ち、最先端半導体製造の為にどのような露光手段が選ばれようと、日々高まるマスクの複雑さや電子ビーム描画のより一層の高精度化の課題を解決するためにマルチビーム技術が必要だという認識の高まりを反映しています。

マルチビームマスク描画、また EUV や NIL の様な次世代露光の代替手段の為に業界基盤を支援するため、イービームイニシアチブはこれらの技術領域への啓蒙努力をより一層行う積りです。

キヤノンナノテクノロジー社のマーケティングと事業開拓担当の副社長であるダグ レズニック (Doug Resnick) 氏は、「キヤノンは 20nm 以下の高解像プロセスへの実用的な半導体リソグラフィの解としてナノインプリントリソグラフィの開発に 10 年以上の投資を行ってきました。NIL が量産適用可能性を有することを実証するために、超高精度の 1 倍の NIL テンプレートを描画する能力は必須のものです。この意味で、NIL のみが恩恵を授かるのではなく、半導体業界全体に恩恵が及ぶ、電子ビーム技術の進展を加速するのを助けるために情報や考えを交換できる開かれた環境を育成するイービームイニシアチブの様な協調的な業界の取り組みをキヤノンは支援します。」と述べています。

イービームイニシアチブのメンバー及び報道各社を招いた年次昼食会は本日開催され、業界著名人による以下の題目の発表が予定されています -- 「NIL マスターテンプレート技術における挑戦」、「EUV と 193nm 液浸露光の比較における 5-nm テストチップ設計と製造の挑戦」及び「新しいマルチビームマスク描画システムの評価結果」

これらの発表資料は本日以降イービームイニシアチブのウェブサイト www.ebeam.org から入手できます。

イービームイニシアチブ (eBeam Initiative) について

イービームイニシアチブは電子ビーム技術に基づく新しい半導体製造方法の探求の為の啓蒙・啓発活動の場を提供する公開討論の場です。

その目指すものは、半導体のエコシステム全体を通じて電子ビーム技術への投資が増え続けるなか、より多くの集積回路 (IC) 設計開始を可能とし、またより迅速な商品化を可能とする手段の選択をする時の障害を低減することです。

会員は半導体エコシステム各方面から構成され、次にあげる各社、各機関よりなります。

aBeam Technologies; アドバンテスト(Advantest); Alchip Technologies; AMTC; Applied Materials; Artwork Conversion; Asetla Nanographics; Cadence Design Systems; キヤノン(Canon); CEA-Leti; D2S; 大日本印刷(Dai Nippon Printing); EQUIcon Software GmbH Jena; eSilicon Corporation; Fraunhofer CNT; 富士通セミコンダクター(Fujitsu Semiconductor Limited); GenISys GmbH; GLOBALFOUNDRIES; Grenon Consulting; 日立ハイテクノロジーズ(Hitachi High-Technologies); ホロン株式会社 (HOLON CO., LTD.); HOYA 株式会社 (HOYA Corporation); IMS CHIPS; IMS Nanofabrication AG; 日本電子 (JEOL); KLA-Tencor; Maglen; Mentor Graphics Corporation; Multibeam Corporation; 日本コントロールシステム(NCS); ニューフレアテクノロジー (NuFlare Technology); Petersen Advanced Lithography; Photronics; Sage Design Automation; Samsung Electronics; STMicroelectronics; Synopsys; tau-Metrix; Tela Innovations; TOOL 株式会社 (TOOL Corporation); 凸版印刷(Toppan Printing); 東芝(Toshiba); Vistec Electron Beam GmbH; Xilinx and ZEISS.

本イニシア

チブは、エレクトロニクス業界におけるあらゆる企業および機関に対し、幅広く参加を募っています。詳しくは www.ebeam.org をご覧下さい。

本件に関するお問い合わせ先：

日本国内：

株式会社 D2S (eBeam Initiative 事務局)
ビル ベーカー (William Baker)
電話 : 045-479-8390 (代)
E-mail : bbaker@design2silicon.com

広報代理店 (英語のみ) :
David Moreno, MCA
Tel: +1-650-968-8900, ext. 125
E-mail: dmoreno@mcapr.com

###

(訳者注記)

文体：平易な口語体に近く、硬くならず、語尾は「です」、「ます」とした。
片仮名表記：片仮名表記は広辞苑に採り上げられている語はそれに倣った。広辞苑に採り上げられていない語については、日常の慣例あるいは訳者の考えでの表記とした。固有名詞や慣例的に英文がそのまま日本語として使用されている語彙については、英文が本文初出の箇所で、片仮名表記（原英文表記）（例えば、イービームイニシアチブ (eBeam Initiative)）とし、以降は片仮名のみの表記とした。また、日常なじみのある場合は、片仮名標記のみとした。
社名表記：日本に本社機能を置く会社については、日本語表記（英語表記）とし、それら以外は全て英語表記のみとした。

イーピーエム イニシアチブ SPIE の学会に於いて 2016 年の主要啓蒙領域を明らかにする (3/4 ページ)